

ALOX FORM

ZHAZTAPEN TEKNIKOAK

Lurrunketa teknologia	PVD-energia handiko arkua
Estalduraren materiala	TiAlN oinarrituta
Estalduraren lodiera	3-6 µm
Kolorea	More
Gogortasuna	3100HV
Deposizio tenperatura	450-480°C
Lan. tenperatura max.	950°C



Micro eta Duplex gama eskuragarri

Estalduraren ezaugarriak

- Urraduraren aurkako erresistentzia altua.
- Gogortasun altua.
- Tenperaturaren aurkako erresistentzia altua.
- Zimurtasun baxua

Aplikazio industrialak

Bere gogortasun altua eta tenperaturaren aurkako erresistentzia dela eta, AloxForm matrizeri aplikazioetarako estandarra bihurtu da, izan hotzeko zein beroko lanetarako.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCAF1